

苏州工业园区2025年2家重点排污单位监测结果公示

企业名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	限值	单位	是否超标	备注
库力索法半导体（苏州）有限公司	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	电镀碱洗塔排口 (DA010)	硫酸雾	2025-06-11	0.86	5.0	mg/m ³	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	电镀碱洗塔排口 (DA010)	氯化氢	2025-06-11	3.0	10	mg/m ³	否	
	半导体行业污染物排放标准 (DB32/3747-2020)	电镀碱洗塔排口 (DA010)	氮氧化物	2025-06-11	<0.7	50	mg/m ³	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	焊针清洗洗涤塔排口(DA008)	非甲烷总烃	2025-06-11	12.6	50	mg/m ³	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	焊针清洗洗涤塔排口(DA008)	氯化氢	2025-06-11	2.9	10	mg/m ³	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	焊针清洗洗涤塔排口(DA008)	硫酸雾	2025-06-11	1.07	5.0	mg/m ³	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	电镀碱洗塔排口 (DA009)	颗粒物	2025-06-11	1.2	20	mg/m ³	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	3#除尘器排放口 (DA001)	颗粒物	2025-06-11	1.2	20	mg/m ³	否	
万博禄（苏州）新型材料有限公司	/	13#排气筒 (DA019)	颗粒物	2025-06-12	1.2	20	mg/m ³	否	排污证限值
	工业炉窑大气污染物排放标准(DB 32/3728-2020)	2#排气筒 (DA021)	颗粒物	2025-06-12	2.0	20	mg/m ³	否	
	工业炉窑大气污染物排放标准 DB32/3728-2020(DB32/3728-2020)	2#排气筒 (DA021)	氟化物	2025-06-12	<0.06	6	mg/m ³	否	
	大气污染物综合排放标准DB 32/4041-2021(DB 32/4041-2021)	2#排气筒 (DA021)	镍及其化合物	2025-06-12	0.00538	1	mg/m ³	否	
	工业炉窑大气污染物排放标准(DB 32/3728-2020)	9#排气筒 (DA026)	颗粒物	2025-06-12	1.3	20	mg/m ³	否	
	工业炉窑大气污染物排放标准(DB 32/3728-2020)	9#排气筒 (DA026)	氮氧化物	2025-06-12	<3	180	mg/m ³	否	
	大气污染物综合排放标准DB 32/4041-2021(DB 32/4041-2021)	9#排气筒 (DA026)	锡	2025-06-12	0.00367	5	mg/m ³	否	
	大气污染物综合排放标准(DB 32/4041-2021)	10#排气筒 (DA013)	颗粒物	2025-06-12	1.0	20	mg/m ³	否	

苏州工业园区2025年2家重点排污单位监测结果公示

企业名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	限值	单位	是否超标	备注
库力索法半导体 (苏州)有限公司	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	总排口(DW001)	化学需氧量	2025-06-11	13	300	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	总排口(DW001)	pH值	2025-06-11	8.3	6-9	无量纲	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	总排口(DW001)	悬浮物	2025-06-11	15	250	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	总排口(DW001)	总有机碳	2025-06-11	4.6	90	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	总排口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2025-06-11	0.786	20	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	总排口(DW001)	石油类	2025-06-11	<0.06	5.0	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	总排口(DW001)	总锌	2025-06-11	0.034	1.0	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	总排口(DW001)	总磷 (以P计)	2025-06-11	0.07	3	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2025-06-11	0.08	1.0	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	总排口(DW001)	总氮 (以N计)	2025-06-11	5.43	35	mg/L	否	